

Нанолитография

Возможность получения разрешения 1.6 нм и менее в аналитическом и технологическом FIB при применении корректора хроматической аберрации

В. А. Жуков, А. И. Титов, А. В. Завьялова

323

Моделирование полупроводниковых приборов, интегральных схем и технологических процессов

Преобразования пористых слоев при высокотемпературном отжиге. Моделирование

Т. Б. Говоруха, А. В. Зверев, И. Г. Неизвестный, Н. Л. Шварц, З. Ш. Яновицкая

334

Моделирование полупроводниковых приборов и интегральных схем

Алгоритмическая модель аналого-цифрового преобразователя конвейерного типа

Ю. Б. Розаткин

345

Тонкие пленки

Особенности передачи деформации от подложки к резистору в виде мезаструктуры

В. М. Любимский

351

Регулирование адгезионной прочности тонких металлических пленок в многослойных структурах

З. И. Талиашвили, Л. Р. Вардосанидзе, Л. Б. Джангидзе, А. Н. Тавхелидзе-младший

359

Плазмохимическое травление

Особенности интенсификации травления кремния в плазме CF_4/O_2^*

Ю. Н. Григорьев, А. Г. Горобчук

368

Аспектнезависимое анизотропное травление кремния в плазмохимическом, циклическом процессе

О. В. Морозов, И. И. Амиров

380

Схемотехника

Устройства выборки-хранения быстродействующих АЦП

А. С. Гуменюк, Ю. И. Бочаров

390
